

Установка плазменной очистки CIONE6-RF (Femtoscience)



Цена:

Цена по запросу

Описание

Установка плазменной очистки CIONE6-RF производства компании Femtoscience (Южная Корея) с двумя режимами плазменной обработки - RIE & PE, в наличии на складе в Санкт-Петербурге.

Плазменные установки предназначены для плазмохимической обработки различных образцов: полупроводниковые пластины, керамические подложки, печатные платы, стекло, кварц и др. Основным применением установок является плазменная очистка подложек, плазменная активация поверхности, создание гидрофильных или гидрофобных поверхностей, плазменное или реактивно-ионное травление, микрофлюидика, точное приборостроение.

Плазменная очистка и активация поверхности – наиболее распространенные плазменные процессы. В процессе плазменной очистки поверхность материала физически очищается от загрязнений за счет бомбардировки ионами газа, а также химически за счет химических реакций. Загрязнения переводятся в газовую фазу и удаляются из камеры откачной системой. В процессе активации на поверхности материала образуются активные радикалы, которые значительно повышают адгезионные свойства и химическую активность материала.

Установки плазменной очистки модели CIONE6-RF с двумя активными электродами (верхний и нижний электрод) и генератором плазмы 13.56 МГц/600 Вт, обеспечивающих работу в режиме плазменного травления (PE) или РИТ (RIE) в зависимости от заданного рецепта. Управление установкой осуществляется при помощи встроенного сенсорного дисплея с GUI-интерфейсом.

Основные преимущества установок Femtoscience — это компактность, простота использования, функциональность и надежность. Установки плазменной очистки Femtoscience уже зарекомендовали себя в рамках работы образовательных институтов, научно-исследовательских лабораторий и мелкосерийных производств изделий электронной техники.

Структура камеры

